

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
C07D 257/04

(11) 공개번호 특1990-0001663
(43) 공개일자 1990년02월27일

(21) 출원번호	특1989-0010241
(22) 출원일자	1989년07월19일
(30) 우선권주장	63-181274 1988년07월19일 일본(JP) 64-54569 1989년03월07일 일본(JP)
(71) 출원인	시오노기세이야구 가부시끼가이샤 요시도시 가쓰오 일본국 오오사카후 오오사카시 주오구 도쇼오마찌 3쵸메 1방 8고
(72) 발명자	나리사다 마사유키 일본국 오오사카 이바라끼시 아유히와 3-24-5 오오따니 미쓰아끼 일본국 나라 나라시 다까비따께쵸 1342 와따나베 후미히코 일본국 나라 기따까쓰라기군 간마끼쵸 오하자시모마끼 726-44 마쓰우라 다까하루 일본국 효오고 니시노미야시 오오모리쵸 5-27 하기시따 산지 일본국 나라 고세시 고세 502 세노 가오루 일본국 효오고 니시노미야시 히노꾸찌쵸 1-10-19
(74) 대리인	이준구, 김승호

심사청구 : 없음

(54) 알케닐테트라졸 유도체

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

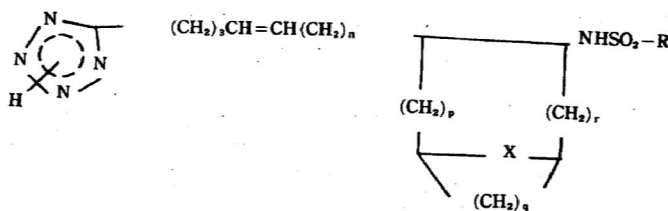
알케닐테트라졸 유도체

본 내용은 요구공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

하기식으로 나타내는 화합물 또는 테트라졸 고리에서의 호변이성체 및 약리학적으로 허용가능한 이의 염.



(식중 R은 나프틸 또는 페닐, 저급알킬, 할로겐, 저급알콕시, 히드록시, 또는 아세톡시로 임의 치환된 페닐이고; X는 메틸렌, 디메틸메틸렌 또는 산소이고; n은 0 또는 1의 정수이고; 단 $p+q+r=2$ 인 조건에서

p 및 r은 각각 0 또는 1의 정수이고, q는 1 또는 2의 정수이다.)

청구항 2

제 1 항에 있어서, X는 메틸렌이고, p 및 r은 각각 q는 2인 화합물.

청구항 3

제 1 항에 있어서, X는 산소이고, p 및 r은 각각 0이고 q는 2인 화합물.

청구항 4

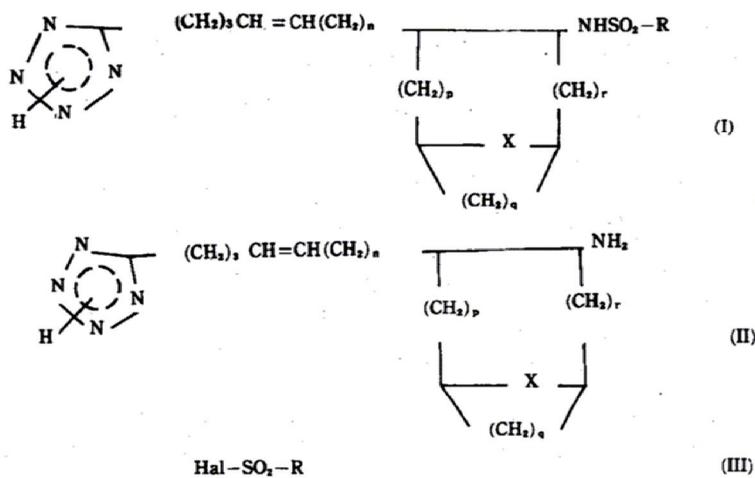
제 1 항에 있어서, X는 디메틸메틸렌이고, n은 1이고 p 및 r은 각각 0 또는 1이고 q는 1인 화합물.

청구항 5

제 1 항에 있어서, (1R,2S,3S,4S)-3-페닐술포닐아미노-2-[(2Z)-6-(5-테트라졸릴)헥스-2-에닐]비스클로[2,2,1]헵탄인 화합물.

청구항 6

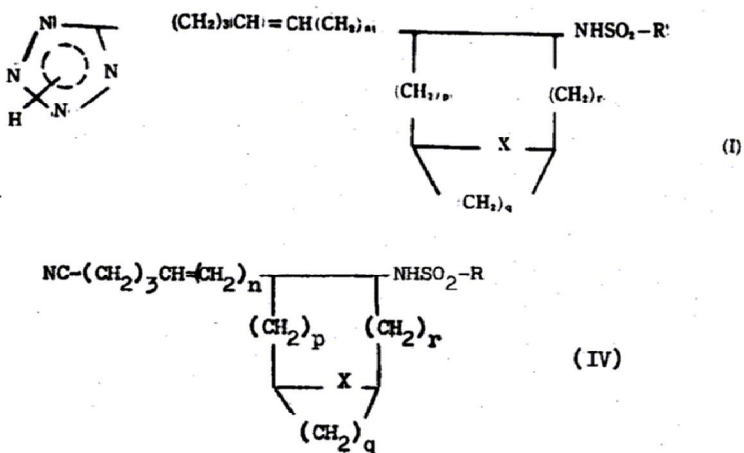
식(II)로 나타내는 화합물을 식(III)으로 나타내는 할라이드와 반응시킴을 특징으로 하는 식(I)로 나타내는 화합물 또는 테트라졸 고리에서의 호변이성체 및 약리학적으로 허용가능한 이의 염의 제조방법.



(식중 R은 나프틸 또는 페닐, 저급알킬, 할로겐, 저급알콕시, 히드록시, 또는 아세톡시로 임의 치환된 페닐이고; X는 메틸렌, 디메틸메틸렌 또는 산소이고; Hal은 할로겐이고; n은 0 또는 1의 정수이고; 단 $p+q+r=2$ 인 조건하에서 p 및 r은 각각 0 또는 1의 정수이고, q는 1 또는 2의 정수이다.)

청구항 7

식(IV)로 나타내는 화합물을 아지드와 반응시킴을 특징으로 하는 식(I)로 나타내는 화합물 또는 테트라졸 고리에서의 호변이성체 약리학적으로 허용가능한 이의 염의 제조방법.



(식중 R은 나프틸 또는 페닐, 저급알킬, 할로겐, 저급알콕시, 히드록시, 또는 아세톡시로 임의 치환된 페닐이고; X는 메틸렌, 디메틸메틸렌 또는 산소이고; n은 0 또는 1이고; 단 $p+q+r=2$ 인 조건하에서 p 및 r은 각각 0 또는 1의 정수이고, q는 1 또는 2의 정수이다.)

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

